Особенности анионного переноса в кристаллах HoF₃ при высоких температурах

© Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев, М. Брайтер*

Институт кристаллографии Российской академии наук, 117333 Москва, Россия * Технический университет, Вена, Австрия

(Поступила в Редакцию 14 июня 2001 г.)

Проведены в широком интервале температур (323–1073 K) исследования анионной проводимости кристаллов HoF₃ со структурой типа β -YF₃ (ромбическая сингония, пр. гр. *Pnma*). Параметры решетки кристаллов HoF₃ $a = 0.6384 \pm 0.0009$, $b = 0.6844 \pm 0.0009$ и $c = 0.4356 \pm 0.0005$ nm. Обнаружено, что во всем изученном интервале температур анизотропия проводимости в кристаллах HoF₃ незначительна. В области $T_c \approx 620$ K происходит смена механизма ионного переноса. Энтальпия активации электропроводности $\Delta H_1 = 0.744$ eV при $T < T_c$ и $\Delta H_2 = 0.43$ eV при $T > T_c$. Наиболее вероятными носителями заряда в кристаллах HoF₃ являются вакансии фтора. Фтор-ионная проводимость равна 5 × 10⁻¹⁰ (323 K), 5 × 10⁻⁶ (500 K) и 2 × 10⁻³ S/cm (1073 K).

Работа поддержана Австрийским фондом им. Л. Майтнер (проект N M00231-CHE).

Фторидные материалы с высокой подвижностью анионов F⁻ — важный класс суперионных проводников. В последние годы круг этих суперионных материалов расширился за счет новых соединений с различными типами структуры, в том числе трифторидов редкоземельных элементов RF₃, принадлежащих к структурному типу ромбического β -YF₃ (пр. гр. *Pnma*) [1–4]. За исключением исследований [1] на частотах 1-10 kHz кристаллов YF₃ и LuF₃, полученных методом отвердевания расплава, мы не знаем работ по электрофизическим свойствам ромбических RF₃ при высоких температурах. Настоящая работа посвящена изучению высокотемпературного (вплоть до 1073 К) анионного переноса в монокристаллах HoF₃ методом импедансной спектроскопии на частотах 0.1-10⁷ Hz. Измерения электрофизических свойств ромбических RF₃ в широком интервале температур необходимы для понимания особенностей механизма их анионной электропроводности и для их практического использования в различных приборах ионики твердого тела.

1. Эксперимент

Монокристаллы HoF₃ были выращены методом направленной кристаллизации из расплава в Институте кристаллографии РАН. Описание методики роста кристаллов дано в [4]. Кристаллы не содержали рассеивающих включений кислородсодержащих фаз и их принадлежность к структурному типу β -YF₃ подтверждена рентгенографически. Параметры решетки полученных кристаллов HoF₃ равны: $a = 0.6384 \pm 0.0009$, $b = 0.6844 \pm 0.0009$ и $c = 0.4356 \pm 0.0005$ nm.

Образцы для исследований представляли собой пластины с типичными размерами толщиной 1 mm и поверхностью 5×5 mm. Поверхности монокристаллических образцов оптически полировали и очищали ультразвуком в ацетоне (Bransonic 221). Качество образцов оценивали с помощью оптического микроскопа Zeiss KL1500-Z. Термический анализ выполнялся на приборе Setaram DTA/TG 92-12 со скоростью 5–10 K/min при 293–1073 К в потоке газообразного азота.

Электрофизические свойства исследовали методом диэлектрических потерь с использованием импедансметра Solarton 1260 (диапазон частот $10^{-1}-10^7$ Hz, напряжение 30 mV). Измерения импеданса кристаллов с блокирующими ионы F⁻ электродами (серебряная паста) выполнены в интервале температур от 323 до 1073 K в потоке N₂. Подробное описание экспериментальной установки дано в [5]. Параметры процесса анионного переноса рассчитывали по формуле $\sigma T = A \exp(-\Delta H/kT)$, где ΔH — энтальпия активации электропроводности.

В обычных условиях эксперимента при повышенных температурах вследствие пирогидролиза на поверхности монокристаллов HoF₃ образовывалась электропроводная



Рис. 1. Влияние пирогидролиза на электропроводность монокристалла HoF₃ (1 — нагревание, объемное сопротивление R_b , 2 — охлаждение, полное сопротивление $R_b + R_f$ и 3 — охлаждение, сопротивление пленки R_f).

пленка, затрудняющая определение объемного сопротивления. На рис. 1 приведены типичные результаты электрофизических измерений без принятия специальных мер предосторожности. К пирогидролизу монокристаллов HoF_3 приводят следы воды в окружающей атмосфере. Очистка поверхностей образцов ультразвуком, измерения в потоке очищенного азота, использование широкого диапазона частот (для разделения вкладов объемного сопротивления монокристалла и сопротивления пленки) и некоторые другие специальные меры позволили провести высокотемпературные исследования электролитных свойств монокристаллов HoF_3 .

2. Результаты и обсуждение

Температурные зависимости ионной проводимости образцов HoF₃ с различной ориентацией показаны на рис. 2. Для всех образцов наблюдалась хорошая воспроизводимость данных в режимах нагрева и охлаждения. Термограммы не показали никаких тепловых эффектов в температурном диапазоне 293-1073 К. Порошкограммы НоF₃ после термического циклирования также не показали никаких следов присутствия других фаз. Зависимости $\sigma(T)$ разбиваются при $T_c \approx 620$ К на два линейных участка, соответствующих различным механизмам ионного переноса, при этом в высокотемпературной области наблюдается уменьшение энтальпии электропроводности. Аналогичные две области на зависимости $\sigma(T)$ наблюдались в кристаллах β -YF₃ (рис. 1 в [3]). Значения предэкспоненциального множителя А и энтальпии ΔH для различно ориентированных образцов HoF₃ приведены в табл. 1. Полученные параметры анионного переноса для кристалов HoF₃ несколько отличаются от данных, полученных авторами [6] для этого кристалла, но в то же вре-



Рис. 2. Температурная зависимость анионной проводимости для монокристаллов HoF₃₃. *1,2* — образец параллелен или перпендикулярен оси *b* соответственно, *3* — неориентированный образец.

Таблица 1. Значения A и ΔH для монокристаллов HoF₃

Ориентация	$\Delta T, K$	$\Delta H, \mathrm{eV}$	$\lg A$, Scm ⁻¹ K
Образец 1,	323-623	0.737	4.61
$\parallel b$	623-1073	0.45	2.34
Образец 1,	323-623	0.745	5.14
$\perp b$	623-1073	0.43	2.78
Образец 2,	323-623	0.765	5.14
$\parallel b$	623-1073	0.37	2.15
Образец 2,	323-623	0.722	4.65
$\perp b$	623-1073	0.45	2.49
Образец 3,	323-623	0.750	4.72
неориентир.	623-1073	0.43	2.14

Таблица 2. Электрофизические характеристики ромбических *R*F₃

RF ₃	Ориентация	$\sigma_{500\mathrm{K}},\mathrm{S/cm}$	$\Delta H, \mathrm{eV}$	Литературная ссылка
TbF ₃	[010]	1×10^{-5}	0.74	[6]
HoF ₃	$\parallel b$	$4 imes 10^{-6}$	0.75	Данная
	$\perp b$	$7 imes 10^{-6}$	0.73	работа
	Неориентир.	3×10^{-6}	0.75	
	»	1×10^{-5}	0.64	[6]
ErF	»	1×10^{-6}	0.74	[4,7]
β -YF ₃	[101]	$2 imes 10^{-6}$	0.71	[6]
	[010]	3×10^{-6}	0.71	[6]
	Неориентир.	2×10^{-6}	0.70	[3]

мя хорошо согласуются с результатами этих же авторов по кристаллам ромбических RF_3 (R = Tb, Er, Y) [3,4,6,7], в которых верхняя температурная граница измерений составляла 923 К (табл. 2). Анизотропия проводимости в кристаллах HoF₃, как и в кристаллах β -YF₃, незначительна и ею можно пренебречь (табл. 1 и 2).

Результаты структурных исследований [8] свидетельствуют о близости мотивов структурных типов тисонитовых и ромбических трифторидов редкоземельных элементов. Для номинально чистых тисонитовых RF3 (R = La - Nd) характерно образование дефектов Шоттки (вакансии V_F и V_{La}), при этом подвижными дефектами являются вакансии фтора $V_{\rm F}^+$, которые отвечают за высокую ионную проводимость $\sigma \sim 10^{-6}$ S/cm при 293 K [9]. Аналогично тисонитовым RF₃, экспериментальные данные по ионному транспорту в ромбических кристаллах *R*F₃ непротиворечиво интерпретируются, если предположить реализацию в их структурах вакансионного механизма электропроводности. В [3] также указывалось, что в кристаллах β -YF₃ именно вакансии V_F являются наиболее вероятными структурными дефектами, ответственными за анионную проводимость. Найденное значение $\Delta H = 0.74 \, \text{eV}$ для кристаллов HoF₃ довольно близко к значению энтальпии миграции вакансий фтора $\Delta H \approx 0.70 \,\mathrm{eV}$ [3] в кристаллах β -YF₃.

Учитывая низкие коэффициенты диффузии катионов в трифторидах, следует заключить, что излом зависимости $\sigma(T)$ при $T_c \approx 620$ К отражает трансформацию механизма анионной проводимости в кристаллах HoF₃. Заметим, что для ромбических трифторидов редкоземельных элементов, также как и для тисонитовых трифторидов [10], выполняется условие $\Delta H_2 < \Delta H_1$, где ΔH_1 и ΔH_2 — энтальпия активации электропроводности при $T < T_c$ и $T > T_c$. Это позволяет предположить участие вакансий $V_{\rm F}$ различных кристаллографических позиций в механизме ионного транспорта.

В структуре тисонита LaF₃ (пр. гр. $P\bar{3}c1$, число формульных единиц z = 6) имеются три подрешетки фтора: F₁, F₂ и F₃, причем количество анионов в элементарной ячейке F₁ : F₂ : F₃ = 12 : 4 : 2. Вдоль оси *с* располагаются ионы F₁ в гофрированных анионных слоях и ионы F₂ и F₃ в плоских катион-анионных слоях. При объяснении электрофизических свойств тисонитов ионы F₂ и F₃ часто объединяют в общую комбинированную подсистему F_{2.3} (при F₂ = F₃ тригональная тисонитовая структура пр. гр. $\bar{3}c1$ с z = 6 переходит в гексагональную тисонитовую структуру пр. гр. P6/mmm с z = 2), тогда имеем $F_1 : F_{2,3} = 2 : 1$. В структуре β -YF₃ (пр. гр. *Ртта*, z = 4) [11,12] вдоль оси b располагаются чисто анионные слои, образованные ионами F₃, и катион-анионные слои, содержащие ионы F2. Количество анионов в элементарной ячейке β -YF₃ F₁ : 2 = 2 : 1. При $T < T_c$ анионный перенос в структуре β -YF₃ преимущественно происходит сначала в одной фторной подсистеме (вероятно, в F_1), затем подключается вторая подрешетка (F₂). В области Т_с происходит интенсивный обмен вакансиями фтора между анионными подсистемами, и при $T < T_c$ анионный перенос охватывает все фторные позиции.

Однако анионная проводимость кристаллов HoF₃ достигает только уровня 2×10^{-3} S/cm при 1073 K, что существенно ниже электропроводности тисонитовых RF_3 ($\sigma \sim 1$ S/cm). Это сильное различие проводимости ионов F⁻ в ромбической и тисонитовой структурах трифторидов лантаноидов находит объяснение с кристаллохимических позиций [13]. Характерным координационными полиэдром R^{3+} является тригональная призма с различной степенью искажения, обеспечивающая минимальное координационное число 6. Способ взаимного расположения таких призм в пространстве приводит к увеличению координационного числа до 9 в структурах типа β -YF₃ и до 11 в структурах типа тисонита.

Высокосимметричная гексагональная структура тисонитового типа построена из перпендикулярных оси *с* слоев, составленных правильными тригональными призмами, заселенными поочередно La и F по мотиву, аналогичному MoS₂. В этом типе структуры фтор занимает две разные позиции: в вершинах полиэдров и в центрах призм из одноименных ионов, последнее весьма необычно для ионных структур. В силу этого обстоятельства при гетеровалентном изоморфном замещении R^{3+} на Ca²⁺ (Sr²⁺, Ba³⁺) вакантными оказываются именно позиции фтора в центре призм. При переходе к низкосимметричной тригональной модификации происходят лишь незначительные подвижки атомов фтора, вызывающие искажение тригональных призм.

В структурах типа ромбического β -YF₃ атомы фтора расположены только в вершинах координационных полиэдров — искаженных тригональных призм, что затрудняет возникновение анионных вакансий (носителей заряда) и как следствие образование твердых растворов MF_2 (M = Ca, Sr, Ba) в ромбических трифторидах. Приведенное кристаллохимическое рассмотрение подтверждается близостью энтальпии активации низкотемпературного (при $T < T_c$) механизма анионного переноса в кристаллах HoF₃ ($T_c \approx 620 \text{ K}$, $\Delta H_1 = 0.74 \text{ eV}$) и тисонитовых твердых растворов Ho_{0.77}Ca_{0.23}F_{2.77} ($T_c \approx 685 \text{ K}$, $\Delta H_1 = 0.7 \text{ eV}$ [14]) и Ho_{0.75}Sr_{0.25}F_{2.75} ($T_c \approx 670 \text{ K}$, $\Delta H_1 = 0.6 \text{ eV}$ [15]).

Авторы благодарят В.С. Сидорова и П.П. Федорова за предоставленные кристаллы.

Список литературы

- [1] M. O'Keeffe. Science 180, 1276 (1973).
- [2] А.И. Лившиц, В.М. Бузник, П.П. Федоров, Б.П. Соболев. Ядерный магнитный резонанс в кристаллах. Институт физики СО АН СССР, Красноярск (1978). С. 90.
- [3] В. Трновцова, П.П. Федоров, Б.П. Соболев, К.Б. Сейранян, С.А. Оганесян, М.Д. Вальковский. Кристаллография 41, 4, 731 (1996).
- [4] V. Trnovcova, P.P. Fedorov, M.D. Valkovskii, T. Sramkova, A.A. Bystrova, B.P. Sobolev. Ionics 3, 313 (1997).
- [5] N.I. Sorokin, M.W. Breiter. Solid State Ionics 99, 241 (1997).
- [6] V. Trnovcova, L. Mitas, C. Jeskova, P.P. Fedorov, B.P. Sobolev. Extended abstracts of VI Int. conf. on Solid State Ionics. Garmisch–Partenkirchen, Germany (1987). P. 165.
- [7] V. Trnovcova, F. Hanic, A.N. Smirnov, P.P. Fedorov, B.P. Sobolev. Proc. Int. conf. Engineering Ceramics-92. Bratislava, Slovakia (1993). P. 183.
- [8] Л.С. Гарашина, Б.П. Соболев, В.Б. Александров, Ю.С. Вишняков. Кристаллография 25, 2, 294 (1980).
- [9] A. Sher, R. Sobolev, K. Lee, M.W. Muller. Phys. Rev. B144, 2, 593 (1966).
- [10] Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев. Кристаллография **39**, *5*, 889 (1994).
- [11] A. Zalkin, D.H. Templeton. J. Amer. Chem. Soc. 75, 2453 (1953).
- [12] Б.П. Соболев, Л.С. Гарашина, П.П. Федоров, И.Л. Ткаченко, К.Б. Сейранян. Кристаллография 18, 4, 751 (1973).
- [13] Л.С. Гарашина, Р.М. Закалюкин, Е.А. Кривандина, Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев. Тез. докл. II Нац. кристаллохим. конф. Черноголовка, Россия (2000). С. 163.
- [14] Н.И. Сорокин, М.В. Фоминых, Е.А. Кривандина, З.И. Жмурова, В.В. Фистуль, Б.П. Соболев. ФТТ 41, 4, 638 (1999).
- [15] Н.И. Сорокин, М.В. Фоминых, Е.А. Кривандина, З.И. Жмурова, Б.П. Соболев. Кристаллография 41, 2, 310 (1996).